

顯影液過濾及液體分離系統

Developer Separate System

- 可分離各種液體
- 分子量處理範圍 500~10,000
- 提升良率，維持顯影液濃度穩定
- 節省成本，大幅降低顯影液消耗
- 提升產速，減少保養週期與工時
- 節省大量用水及排水，降低廠務負擔
- 自動清洗，濃度管理，使用效果及壽命有保障
- 可擴充各種功能滿足生產條件
- 處理量 1~100 CMH
- 此系統已榮獲 4 國專利



※ KOH 顯影液

	過濾前	過濾後
		
導電度 $\mu\text{S}/\text{cm}$	2277	2856
PH值(ph)	10.39	10.38
總溶解固體TDS(ppm)	1428	1138

※ NaOH 顯影液

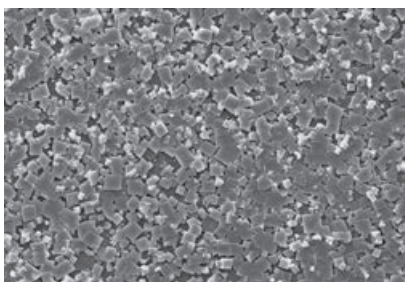
	過濾前	過濾後
		
導電度 $\mu\text{S}/\text{cm}$	3860	3446
PH值(ph)	10.43	10.40
總溶解固體TDS(ppm)	1932	1728

※ Na_2CO_3 顯影液

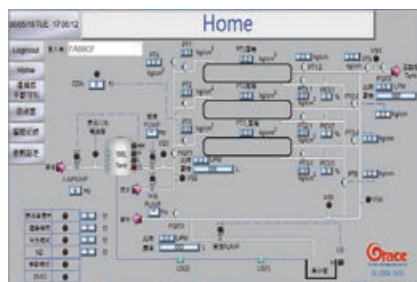
	過濾前	HP濾芯	UHP濾芯
			
導電度 $\mu\text{S}/\text{cm}$	14970	14770	14580
PH值(ph)	11.01	11.01	11.01
總溶解固體TDS(ppm)	7480	7380	7290

※ 半導體化學研磨廢液(CMP)

	過濾前	過濾後
		
砷(As)含量(mg/kg)	1260	661
鎵(Ga)含量(mg/kg)	691	0
固含量(mg/g)	2.94	0.792



化學膜入水面 Na_2CO_3 的結晶



操作介面



系統配置